画像解像度が向上した非冷却赤外線イメージセンサ

Uncooled Infrared Radiation Image Sensor

本多浩大 舟木 英之 ■ HONDA Hiroto ■ FUNAKI Hidevuki

赤外線イメージセンサは、人肌から自然放射される赤外線を検知して温度分布を画像化することで、暗闇の中でも人物を検出 でき、車載用の前方歩行者検知装置や、高機能人感センサ、プラント監視カメラなどに応用できる。しかし、本格的に普及させ るためには、更に画像解像度を上げる必要があった。

東芝は、320×240 画素 (QVGA: Quarter Video Graphics Array) を持ち、ノイズ等価温度差 (NETD: Noise Equivalent Temperature Difference) 0.25 Kを達成した非冷却赤外線イメージセンサを開発した。MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) プロセスの改善で画素を微細化し、画素ピッチを従来品の32 μmから22 μmに縮小する ことで従来と同じチップサイズと感度を保ったまま、多画素化を実現した。また、読出し回路のノイズ低減により、温度分解能の 目安となる NETD を向上させた。

Toshiba has developed a quarter video graphics array (QVGA) (320 x 240 pixels) uncooled infrared radiation image sensor that achieves a noise equivalent temperature difference (NETD) of 0.25 K. As this sensor can detect a person in the dark from the image of the temperature distribution by sensing far-infrared radiation emitted by the skin, it is applicable to many areas including pedestrian detection sensors for automobiles, human detection sensors, security sensors, and so on.

In order to increase the resolution, or the number of pixels, we have utilized a microelectromechanical systems (MEMS)-based process to reduce the pixel pitch from 32 µm to 22 µm, which realizes a QVGA image sensor of the same sensitivity and chip size, and decrease the read-out circuit noise to improve the NETD from 0.55 K to 0.25 K.

1 まえがき

赤外線イメージセンサは,対象物から自然に放射される赤 外線を検知して温度分布を画像化でき,投光器のような光源 が不要である。ヘッドライトの当たらない前方の歩行者を検知 して警告を出す車載用の前方歩行者検知装置や,高機能人感 センサ,プラント監視用カメラなど,応用分野は多岐にわたっ ている。

冷却器を用いて約-200℃で動作する冷却型の赤外線イメージセンサと異なり、室温下で動作する非冷却赤外線イメージセンサは高価な冷却器が不用であり、製造コストを低減できることから近年盛んに開発されている^{(1), (2), (3)}。

この非冷却赤外線イメージセンサを前方歩行者検知や監視 カメラなどに本格的に普及させるためには、多画素化して画像 解像度を上げることが課題になっていた。例えば、50 m以上 遠方の人物を認識するためには、320×240 画素以上の解像 度が必要である。しかし、レンズとパッケージを従来品と同じ サイズに保ったままで多画素化することが求められており、画 素ピッチの縮小と感度を維持する技術が必要であった。

東芝は、画像解像度を上げるため、画素ピッチを従来品の 32 μmから22 μmに縮小した非冷却赤外線イメージセンサを



開発した。ここでは、その概要と特長などについて述べる。

2 非冷却赤外線イメージセンサの構造と動作原理

非冷却赤外線イメージセンサの画素構造を図1に示す。被 写体からの赤外線輻射は8~12 µmの波長帯に分布してお り、センサセル上の赤外線吸収膜で吸収されて熱エネルギー に変換される。センサセルは、シリコン(Si) 基板をエッチング して形成した空洞部の上に、支持脚と呼ばれる細長い梁(は り)構造で支持されている。このような中空構造は、MEMS プロセスで形成する。センサセルは、この構造によってSi基 板から断熱され、効率的に熱エネルギーを温度上昇に換える ことができる。

更に,センサセル内に設けられたダイオードの順方向特性の 温度依存性を利用し,温度上昇を電気信号に変換して読み出 す。すなわち,センサセルは,光エネルギーを熱エネルギーに いったん変換し,次にそれを電圧信号に変換する間接検出タ イプの光センサである。

赤外線イメージセンサの性能を示す指標は,温度分解能の 目安となるNETDであり,式(1)で表わされる。

$$NETD = \frac{\Delta T \cdot V_n}{V_{sig}} \tag{1}$$

△T:被写体の温度差

V_n:画素出力段換算のノイズ電圧

Vsig:画素出力段換算の信号電圧

NETDの単位はKであり, SN比 (信号対雑音比) が1とな るときの被写体温度差を表している。NETDの値が小さいほ ど温度分解能が高いことから, V_nを低減するか, 被写体に温 度差が生じたときのV_{sig}を大きくすることがNETDの向上につ ながる。

3 高断熱性による解像度向上

式(1)のうち, 信号電圧 Vsig は式(2)で表わされる。

$$V_{sig} = \frac{PA\gamma}{G_{th}} \cdot \frac{dV}{dT}$$
(2)

P :単位面積当たりの入射エネルギー(W/m²)

- *A* :センサセルの面積 (m²)
- *G_{th}* :支持脚の熱コンダクタンス(W/K)

y :赤外吸収膜の吸収率

dV/dT:ダイオードの熱電変換効率

赤外線照射によるセンサセルの温度上昇は、入射エネル ギーと散逸エネルギーのバランスによって決まり、式(2)は平衡 状態が実現しているときの信号電圧を示している。

NETDを決定する最大の要素は*G*_{th}, すなわち支持脚の断 熱性能である。*G*_{th}の値が小さいほど散逸エネルギーが少な いため, センサセルの温度上昇は高くなり, 感度が高くなる。 一方, 熱が逃げにくくなるため, 被写体の動きに対する応答速



度が遅くなるというトレードオフ (二律背反)の関係があり,設 計の際には注意が必要になる。

電圧信号を読み出す際に、ダイオードには一定の I_f (順方向 電流)が流れる。ダイオードの順方向特性、すなわち I_f - V_f (順方向電圧)特性を図2に示すが、ダイオードの接合部の温 度が上昇すると、 I_f - V_f 特性は低電圧側にシフトする。このシ フト量はdV/dTで表され、ダイオードの直列接続個数に比例 般 論 文



Cross-sectional images of supporting legs of 32 μm and 22 μm pixel-pitch infrared image sensors

して大きくなる。当社は、ダイオードをセンサセル内に10個配 置し、直列接続することで*dV/dT*を高めている。センサセル 温度が1K変化すると、ダイオード10個直列時の*V*_fは約 12 mV変化する。

レンズ及びパッケージを従来品と同じサイズに保ったままで 多画素化を実現するには、画素ピッチを縮小することが必要に なる。画素ピッチを縮小することで*A*が減少するので、NETD を同等に保つためには*G*_{th}の低減、すなわち支持脚の高断熱 化が必須である。

今回当社は、MEMSプロセスを改善し、支持脚スリミング 技術を導入して、支持脚の太さと高さをそれぞれ半減し、G_{th} をセンサセルの面積縮小分に相当する約40%に低減できた。 従来の32 µmピッチと新たに開発した22 µmピッチの各画素 の平面及び支持脚部断面の比較を**図3**に示す。

式(2)におけるAとG_{th}を等しくスケールダウンできたため, NETDを従来と同等の約0.55 Kに保ったまま,画素ピッチを 32 µmから22 µmに縮小できた。これにより,チップサイズを 保持しながら,従来の160×120 画素から320×240 画素への 多画素化を実現し,小型セラミックパッケージに実装すること ができた。

4 ノイズ低減のアプローチ

非冷却赤外線イメージセンサは,仮に断熱構造を最適化し て得られる信号を最大にできたとしても,被写体の温度変化 に対応した信号電圧は非常に微小である。

今回当社は、まず読出し回路のトランジスタのノイズ、なか でも赤外線イメージセンサの駆動周波数帯で支配的である1/f ノイズに着目した。1/fノイズは、その名のとおり周波数に反 比例して低周波になるほど大きくなり、トランジスタでは式(3) で表わされる。

$$\delta I_{\rm D} = \int \sqrt{\frac{\mathrm{K}_{\rm F}}{C_{OX} L^2}} \frac{I_{\rm D}^{\mathrm{A}_{\rm F}}}{f^{\mathrm{E}_{\rm F}}} df \tag{3}$$

- δI_D:一定のI_D (ソース-ドレイン間電流)を流す際に
 含まれるノイズ電流
- Cox:単位面積当たりのゲート酸化膜容量
- L :ゲート長
- f : 駆動周波数
- K_F, A_F, E_F:トランジスタ作製プロセスに依存するパラ メータ

ここで、積分記号は動作周波数帯での積分を表している。 このセンサでもっともSN比に影響するのは、ダイオードに 定電流を流す定電流トランジスタであり、式(1)中のV_nは式(3)



の $\delta I_{\rm D}$ に直接比例する。式(3)から,定電流トランジスタのLを 大きくするほど $\delta I_{\rm D}$,すなわち V_n は低減されることがわかる。

実際にLの異なる複数のトランジスタのノイズを測定し,10Hz から1kHzまで積分した結果を図4に示す。電流値を1,10, 100 µAにそれぞれ設定して1/fノイズを測定した結果,理論 式どおり,Lに反比例してノイズが小さくなる傾向が見られた。

この結果を用いてLを最適化し,NETDを比較した結果, 図5に示すようにNETDの平均値が0.57 Kから0.25 Kまで 低減した。Lは,ゲート面積増大によるチップ面積の占有,並 びにゲート容量の増大が問題にならない範囲内で最大値を採 用した。NETDが0.25 Kのセンサを用いて屋外を撮影した画 像を図6に示す。車両のタイヤ付近など,高温の物体が白く 映っているのがわかる。

開発した非冷却赤外線イメージセンサの基本仕様を**表1**に 示す。





ており、車両のタイヤ付近など、高温の物体が白く映っている。 Example of outdoor imaging

Basic specifications of Toshiba infrared image sensor	
項目	基本仕様
画素ピッチ	22 µm
有効画素数	320×240画素
チップサイズ	8.5×8.5 mm
イメージエリアサイズ	7.04 × 5.28 mm
パッケージサイズ	16×16×1.75 mm
F値*	1.0
フレームレート	30フレーム/s
NETD	0.25 K

5 あとがき

今回, MEMSプロセスを改善し, 画素ピッチを従来品の 32 µmから22 µmに微細化することで、感度とチップサイズを 保ったままで、従来の160×120 画素から320×240 画素への 多画素化を実現した。また、トランジスタの1/fノイズ低減の アプローチからSN比を向上させ、NETD 0.25 Kの非冷却赤 外線イメージセンサを実現することができた。

今後は、NETDが0.1 K以下となる高感度化を図るととも に、連続動画撮影に必要なシャッターレス化に挑戦し、いっそ うの高機能化を進めていく。

文 献

- (1) Ohnakado, T., et al. "Novel readout circuit architecture realizing TEC-less operation for SOI diode uncooled IRFPA". Proc. SPIE 7298. Orland, FL, USA, 2009-04, SPIE The International Society for Optical Engineering. 2009, p.72980V-1 - p.72980V-10.
- (2) Ueno, R., et al. "Uncooled infrared radiation focal plane array with low noise pixel driving circuit". IDW/AD'09 Proc. Miyasaki, Japan, 2009-12, The Institute of Image Information and Television Engineering and The Society for Information Display. 2009, p.1451 - 1454.
- (3) Funaki, H., et al. "160 x 120 pixel uncooled TEC-less infrared radiation focal plane array on a standard ceramic package". Proc. SPIE 7298. Orland, FL, USA, 2009-04, SPIE The International Society for Optical Engineering. 2009, p.72980W-1 - 72980W-9.



文

般

論



本多 浩大 HONDA Hiroto

研究開発センター 表示基盤技術ラボラトリー研究主務。 赤外線イメージセンサの研究・開発に従事。 Electronic Imaging Lab.

舟木 英之 FUNAKI Hidevuki 研究開発センター 表示基盤技術ラボラトリー研究主幹。 イメージセンサの研究・開発に従事。 Electronic Imaging Labs.